



基片偏压对磁控溅射制备TiB₂涂层结构及性能的影响

谷文翠^{1,2}, 李寿德^{1,3}, 王怀勇², 陈春立¹, 李朋², 黄峰²

1. 西安建筑科技大学 材料与矿业学院, 西安 710055;
2. 中国科学院 宁波材料技术与工程研究所, 浙江 宁波 315200;
3. 西安墙体材料研究设计院, 西安 710000

Influence of Bias Voltage on Microstructure and Properties of Magnetron Sputtering TiB₂ Coating

GU Wen-cui^{1,2}, LI Shou-de^{1,3}, WANG Huai-yong², CHEN Chun-li¹, LI Peng², HUANG Feng²

1. College of Materials and Mineral Resources, Xi'an University of Architecture and Technology, Xi'an 710055 China;
2. Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering, Chinese Academy of Sciences, Ningbo 315200 Zhejiang China;
3. Xi'an Research and Design Institute of Wall and Roof Materials, Xi'an 710000 China

[摘要](#) [图/表](#) [参考文献](#) [相关文章 \(15\)](#)

中国航空学会
中国航空工业集团公司 主办
北京航空材料研究院

版权所有 © 《航空材料学报》编辑部 总访问量:

地址: 北京81信箱44分箱 邮政编码: 100095

电话: 010-62496277 E-mail: hkclxb@biam.ac.cn

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn